

MOCVD 装置

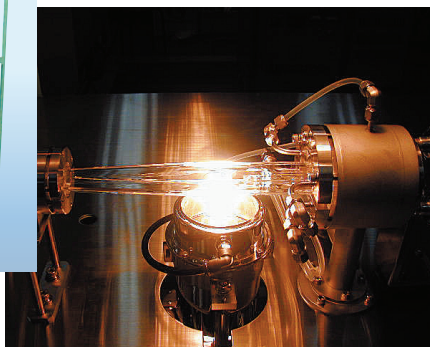
液体原料供給 MOCVD 装置

酸化物材料開発用として液体原料供給が可能な MOCVD 装置を取り揃えております。

MPC1100V



産業技術総合研究所殿納入設備



- リアクタ：横型石英製
- 基板サイズ：φ1 インチ×1 枚
- 基板加熱：ランプ加熱方式
- 最高加熱温度：800℃(制御用熱電対値)
- 流量制御：液体マスフローコントローラ
- 気化方式：熱式気化器
- 適用：酸化物など

MPC2100H



産業技術総合研究所殿納入設備

- リアクタ：縦型ステンレス製
- 投入室：トランスファーロード付
- 基板サイズ：φ2 インチ×1 枚
- 基板加熱：抵抗加熱方式
- 最高加熱温度：800℃(制御用熱電対値)
- 流量制御：液体マスフローコントローラ
- 気化方式：熱式気化器
- 適用：酸化物など

MPC6100



奈良先端科学技術大学院大学殿納入設備

- リアクタ：縦型ステンレス製
- 投入室：トランスファーロード付
- 基板サイズ：φ6 インチ×1 枚
- 基板加熱：抵抗加熱方式
- 最高加熱温度：800℃(制御用熱電対値)
- 流量制御：液体マスフローコントローラ
- 気化方式：熱式気化器
- 適用：PZT 含む酸化物など